

# 抵抗加熱型 CVD 炉チーム

<氏名> 服部 昌    <役職> チームリーダー    <所属> 光洋サーモシステム株式会社

## <開発内容>

半導体の製造は、「膜をつけて、回路を焼き込む」ことの繰り返しで、「膜付け」には多くの場合熱処理が用いられます。熱処理の熱源にはいろいろな方式がありますが、抵抗加熱方式は、じっくり時間をかけた処理が必要な用途に適しています。本チームは、抵抗加熱による熱 CVD 装置を中心に、半導体の製造に必要な各種熱処理装置を揃えていきます。

## <自己紹介>

社会人になって 30 年余り、機械設計者としてスタートしたのが、いつの間にか計測・制御の世界で生きるようになりました。最近では、太陽電池用熱処理装置やマイクロ波加熱装置を手掛けていましたが、“ミニマルファブ構想”に共感して半導体事業の新規分野として参画をしました。まず、確立された技術で、一時も早く、“ミニマル”によるデバイス作りを実現し、次には、新しい技術を“ミニマル”に導入して、「日本のモノづくりに新しい輝きを」、そして、「次代に新しい産業を」もたらせるように頑張りたいと思います。

## ミニマルファブ 1100°Cドライ酸化

JTEKT  
Koyo TOYODA

